

(3)

23
Corr. WO 03/072625

JP 2005-519146 A 2005. 6. 30

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2005-519146

(P2005-519146A)

(43) 公表日 平成17年6月30日(2005. 6. 30)

(51) Int.C1.⁷

C08G 18/67
C08F 290/06
C08G 18/83
C08G 59/20
G02B 6/00

F 1

C08G 18/67
C08F 290/06
C08G 18/83
C08G 59/20
G02B 6/00

391

テーマコード(参考)

2H047
2H050
4J034
4J036
4J127

審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全 23 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号

特願2003-571327 (P2003-571327)

(86) (22) 出願日

平成14年12月18日 (2002. 12. 18)

(85) 翻訳文提出日

平成16年10月28日 (2004. 10. 28)

(86) 国際出願番号

PCT/KR2002/002381

(87) 国際公開番号

W02003/072625

(87) 国際公開日

平成15年9月4日 (2003. 9. 4)

(31) 優先権主張番号

2002-11002

(32) 優先日

平成14年2月28日 (2002. 2. 28)

(33) 優先権主張国

韓国 (KR)

(71) 出願人

504329148

ルバンティックス・カンパニー・リミテッド

大韓民国、キュンキード 425-110
、アンサンーシ、モクネードン、ナンバー
403-2

(74) 代理人

100058479

弁理士 鈴江 武彦

(74) 代理人

100091351

弁理士 河野 哲

(74) 代理人

100088683

弁理士 中村 誠

(74) 代理人

100108855

弁理士 蔵田 昌俊

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】光導波路用光硬化性樹脂組成物およびそれから製造された光導波路

(57) 【要約】

【課題】光導波路の製造に有用な光硬化性樹脂組成物の提供。

【解決手段】下記式(I)のフッ素化された光硬化性ウレタンオリゴマー、反応性モノマーおよび光開始剤を含む、光導波路の製造に使用するための光硬化性樹脂組成物。

【化1】



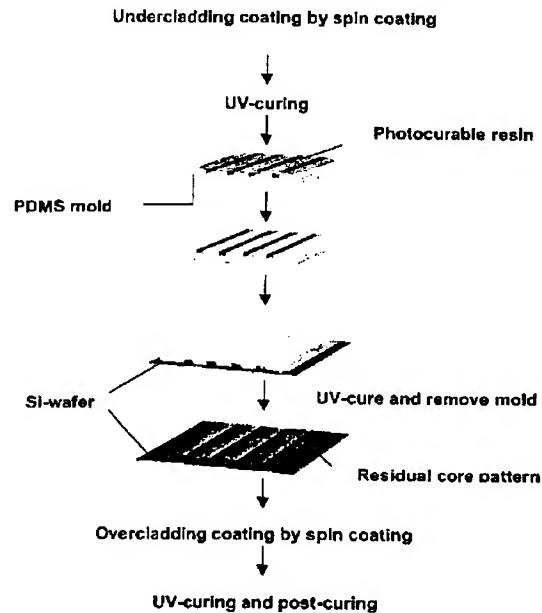
(式中、

R₁は、-CH₂O-または-CH₂(OCH₂CH₂)_mO-；

R₂は、炭素数6～100の芳香族または脂肪族炭化水素基；

R₃は、炭素数2～10の芳香族または脂肪族炭化水素基；

R₄は、メタ(アクリレート)基またはエポキシ基であ

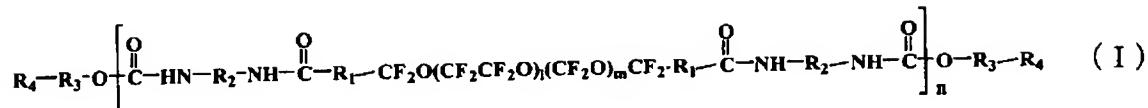


【特許請求の範囲】

【請求項 1】

下記式 (I) のフッ素化された光硬化性ウレタンオリゴマー。

【化 1】



(式中、

10

R_1 は、 $-CH_2O-$ または $-CH_2(OCH_2CH_2)_mO-$;

R_2 は、炭素数 6 ~ 100 の芳香族または脂肪族炭化水素基；

R_3 は、炭素数 2 ~ 10 の芳香族または脂肪族炭化水素基；

R_4 は、メタ (アクリレート) 基またはエポキシ基である)。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の式 (I) のフッ素化された光硬化性ウレタンオリゴマー、反応性モノマーおよび光硬化性開始剤を含む、光導波路の製造に使用するための光硬化性樹脂組成物。

【請求項 3】

前記フッ素化された光硬化性ウレタンオリゴマーが、ポリオールとジイソシアネートをウレタン反応触媒の存在下で反応させた後、得られた生成物と少なくとも一つの (メタ) アクリロイル基および一つのヒドロキシ基を有するヒドロキシ (メタ) アクリロイル基、または少なくとも一つのエポキシ基および一つのヒドロキシ基を有するヒドロキシエポキシをウレタン反応触媒および重合開始剤の存在下で反応させることによって製造されることを特徴とする、請求項 2 記載の光硬化性樹脂組成物。

20

【請求項 4】

前記ポリオールが 500 ~ 10,000 の平均分子量を有し、フッ素化されたパーフルオロポリエーテルポリオールまたはパーフルオロポリエーテル鎖の末端に非フッ素化ポリエーテル基を有するパーフルオロポリエーテルポリオールを含むことを特徴とする、請求項 3 記載の光硬化性樹脂組成物。

30

【請求項 5】

前記ジイソシアネートが、イソホロンジイソシアネート (IPDI)、1,6-ヘキサンジイソシアネート (HDI)、1,8-オクタメチレンジイソシアネート、テトラメチルキシレンジイソシアネート (TMXDI)、4,4'-ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート (HMDI)、4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート、3,3'-ジメチル-4,4'-ビフェニレンジイソシアネート、3,3'-ジメチルジフェニルメタン-4,4'-ジイソシアネート、4-ブロモ-6-メチル-1,3-フェニレンジイソシアネート、4-クロロ-6-メチル-1,3-フェニレンジイソシアネート、2,4-ジイソシアネートで末端化されたポリ (1,4-ブタンジオール) トリレン、ジイソシアネートで末端化されたポリ (1,4-ブタンジオール) イソホロン、2,4-ジイソシアネートで末端化されたポリ (エチレンジペート) トリレン、ポリ [1,4-フェニレンジイソシアネート-1-コ-ポリ (1,4-ブタノール)] ディイソシアネート、ポリヘキサメチレンジイソシアネート、2,4-ジイソシアネートで末端化されたポリ (プロピレンジリコール) トリレン、ポリ (テトラフルオロエチレンオキシド-1-ジフルオロメチレンオキシド) α , ω -ジイソシアネート、2,4-トルエンジイソシアネート、2,5-トルエンジイソシアネート、2,6-トルエンジイソシアネート、1,5-ナフタレンジイソシアネートおよびこれらの混合物からなる群から選ばれることを特徴とする、請求項 3 記載の光硬化性樹脂組成物。

40

【請求項 6】

前記少なくとも一つの (メタ) アクリロイル基および一つのヒドロキシ基を有するヒド

50

ロキシ（メタ）アクリレートが、2-ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、2-ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、2-ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、1-ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、2-ヒドロキシ-3-フェニルオキシプロピル（メタ）アクリレート、ネオペンチルグリコールモノ（メタ）アクリレート、4-ヒドロキシシクロヘキシル（メタ）アクリレート、1, 6-ヘキサンジオールモノ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールペンタ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールペンタ（メタ）アクリレート、2-メタクリロキシエチル2-ヒドロキシプロピルフタレート、グリセリンジ（メタ）アクリレート、2-ヒドロキシ-3-アクリロイルオキシプロピル（メタ）アクリレート、ポリカプロラクトンポリオールモノ（メタ）アクリレートおよびこれらの混合物からなる群から選ばれることを特徴とする、請求項3記載の光硬化性樹脂組成物。

10

【請求項7】

前記少なくとも一つのエポキシ基と一つのヒドロキシ基を有するヒドロキシエポキシが、グリシドールまたはエポキシ化テトラヒドロベンジルアルコールであることを特徴とする請求項3記載の光硬化性樹脂組成物。

【請求項8】

前記光反応性モノマーが少なくとも一つの（メタ）アクリロイル基を有する（メタ）アクリレートまたは少なくとも一つのエポキシ基を有する光反応性モノマーであることを特徴とする請求項2記載の光硬化性樹脂組成物。

20

【請求項9】

前記（メタ）アクリレートが、フッ素化された（メタ）アクリレートまたは非フッ素化（メタ）アクリレートであり、前記フッ素化された（メタ）アクリレートが、2-ペーフルオロオクチルエチルアクリレート、2-ペーフルオロオクチルエチルメタクリレート、2, 2, 3, 4, 4-ヘキサフルオロブチルメタクリレート、2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロピルメタクリレート、トリフルオロエチルメタクリレート、2-ペーフルオロアルキルエチルアクリレートおよび2-ペーフルオロアルキルエチルメタクリレートからなる群から選ばれ；前記非フッ素化（メタ）アクリレートが、2-ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、2-ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、2-ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、1-ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、2-ヒドロキシ-3-フェニルオキシプロピル（メタ）アクリレート、テトラヒドロフルフリル（メタ）アクリレート、イソデシル（メタ）アクリレート、2-(2-エトキシエトキシ)エチル（メタ）アクリレート、ステアリル（メタ）アクリレート、ラウリル（メタ）アクリレート、2-フェノキシエチル（メタ）アクリレート、イソボルニル（メタ）アクリレート、トリデシル（メタ）アクリレート、ポリカプロラクトン（メタ）アクリレート、フェノキシテトラエチレングリコール（メタ）アクリレート、イミドアクリレート、エトキシル化されたノニルフェノールアクリレート、エチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ジエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、トリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、テトラエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ポリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、1, 6-ヘキサンジオールジ（メタ）アクリレート、1, 3-ブチレングリコールジ（メタ）アクリレート、トリプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、エトキシ化ビスフェノールAジ（メタ）アクリレート、シクロヘキサンジメタノールジ（メタ）アクリレート、トリシクロ[5. 2. 1. 0^{2, 6}]デカンジメタノールジアクリレート、トリス[2-(アクリロイルオキシ)エチル]イソシアヌレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、エチレンオキシド3モル付加されたトリメチロールプロパントリアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、トリス(アクリロオキシエチル)イソシアヌレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート、カプロラクトン変性ジペンタエリスリトールヘキサアクリレートからなる群から選ばれる請求項8記載の光硬化性樹脂組成物。

30

40

【請求項10】

50

前記少なくとも一つのエポキシ基を有する光反応性モノマーが、3, 4-エポキシシクロヘキシルメチル-3, 4-エポキシシクロヘキサンカルボキシレート、ビス-(3, 4-エポキシシクロヘキシル)アジペート、3-エチル-3-ヒドロキシメチルオキセタン、1, 2-エポキシヘキサデカン、アルキルグリシジルエーテル、2-エチルヘキシルジグリコールグリシジルエーテル、エチレングリコールジグリシジルエーテル、ジエチレングリコールジグリシジルエーテル、PEG # 200ジグリシジルエーテル、PEG # 400ジグリシジルエーテル、プロピレングリコールジグリシジルエーテル、トリプロピレングリコールジグリシジルエーテル、PPG # 400ジグリシジルエーテル、ネオペンチルグリコールジグリシジルエーテル、1, 6-ヘキサンジオールジグリシジルエーテル、水素化ビスフェノールAジグリシジルエーテル、プロピレンオキシド変形ビスフェノールAのジグリシジルエーテル、ジブロモネオペンチルグリコールジグリシジルエーテルおよびトリメチロールプロパントリグリシジルエーテルからなる群から選ばれることを特徴とする請求項8記載の光硬化性樹脂組成物。
10

【請求項11】

複屈折率が 1×10^{-4} 以下であり、熱分解温度が300°C以上であり、屈折率を1.38~1.54の範囲に調節でき、粘度を50~2000cpsの範囲に調節できることを特徴とする請求項2~10のいずれか一項に記載の光硬化性樹脂組成物。

【請求項12】

請求項2~10のいずれか一項に記載の光硬化性樹脂組成物を下部クラッド層としてシリコンウェハ上にコーティングした後、コーティングされた層をUV照射によって光硬化させる段階；前記光硬化性樹脂組成物をコア層としてエッチングされたコアパターンを有するシロキサンモールド上にコーティングした後、コーティングされたコア層をシリコンウェハ上にコーティングされた下部クラッド層に付着し、UV照射によってコア層を光硬化させた後、シロキサンモールドを除去する段階；および前記光硬化性樹脂組成物を上部クラッド層としてコア層上にコーティングした後、上部クラッド層をUV照射によって光硬化させる段階を含む、光導波路の製造方法。
20

【請求項13】

請求項12の方法によって製造された光導波路。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、熱安定性および光透過度が改善された光硬化性樹脂組成物、およびマイクロモールディング技法によって前記樹脂組成物から製造された光導波路に関する。

【背景技術】

【0002】

情報通信分野において、光導波路の開発は巨大容量の情報通信を可能にする重要な課題として認識されている。光導波路のような光通信部品を製造するための材料として、通常ガラスまたはその他の結晶性無機材料が使用してきた。しかし、これらの材料は高価であり、加工が難しいという短所がある。

【0003】

最近、PMMA(ポリメチルメタクリレート)およびPS(ポリスチレン)のような高分子素材は、ガラスまたはその他の結晶性無機材料に比べて安価であり、加工が容易であるため、より一般的に用いられている。このような高分子素材を用いる場合、通常の材料を用いた場合よりも光導波路の波長域幅が広く、柔軟性が高い薄膜型光導波路を提供できる。また、前記高分子素材に官能性化合物または官能基を混入することによって光導波路が得られる。
40

【0004】

しかし、PMMAおよびPSは、近赤外線領域、すなわち、1.0~1.8μmの波長帯において分子中のC-H結合が光を吸収するので、重水素化またはフッ素化されたPMMA(すなわち、水素原子が重水素またはフッ素原子で置換されたPMMA)が開発され
50

た。このような重水素化またはフッ素化されたPMMAの吸光帯域は近赤外線領域から遠赤外線領域に移動する。

【0005】

前述の光導波路のコアを構成するPMMA、PSおよび重水素化またはフッ素化されたPMMAはガラス転移温度が低い。たとえば、PMMAおよび重水素化されたPMMAのいずれもガラス転移温度が約100°Cであり、これらは熱処理によって容易に軟化し得るため熱安定性が低い（非特許文献1参照）。

【0006】

低い熱安定性の問題を解決するために、日本電気電話株式会社(NTT Co., Ltd)は、特定の過フッ素化されたポリイミド重合体を開発した。これらの重合体は大きい複屈折率によって偏光独立が難しく、比較的大きい吸収性による光損失が生じるという問題がある（非特許文献2参照）。

10

【0007】

アライドシグナル社(Allied Signal Co., Ltd.)は、アクリレートの光架橋(photo-cross linking)特性を用いて、最大限高い、たとえば、350°Cの熱分解温度(T_d)を有する、熱安定性の高いUV-硬化性フッ素化されたアクリレート(UV-curable fluorinated acrylate)を開発した。前記UV-硬化性フッ素化されたアクリレートは1.3~1.6の範囲で屈折率を連続的に調節でき、複屈性(Δn)が0.0008と低く、1.3μmおよび1.55μm波長における光損失がそれぞれ0.03dB/cmおよび0.05dB/cmと低い。

20

【0008】

さらに、水素原子がフッ素および塩素で置換されたポリイミドが開発されたが、これは複屈折が非常に大きい（非特許文献3参照）。また、熱硬化技術によって製造された、熱硬化性のフッ素化されたポリアリーレンエーテルは熱安定性の面で優れるが、生産性が低い（非特許文献4参照）。

【0009】

したがって、近赤外線領域における光損失が少なく、複屈折率が低く、低い屈折率を有する伝統的な光ファイバと同等な光導波路用光硬化性樹脂組成物が依然として要求されている。

【0010】

伝統的に、導波路は導波路の形態と一致するマスクセットをコーティングされたコア層基板に塗布し、フォトリソグラフィー法によって基板をエッチングしてパターンを形成し、マスクを取り外した後、導波路材料層を付着することを含む工程によって製造されてきた。しかし、このような通常の方法は、製造に多くの時間がかかり、エッチング工程が難しく、多重モード導波路の場合、单一モード導波路とは異なり、コア物質を40μm以上の深さにエッチングしなければならないという問題がある。

30

【0011】

したがって、本発明者らは、前記で提示した必要条件を満足する新規な光硬化性組成物およびマイクロモールディング方法を用いて前記光硬化性樹脂組成物から製造された光導波路を開発することによって本発明を完成するに至った。

40

【非特許文献1】S. Imamura et al., Electronics Letters, 27, 1342, 1991

【非特許文献2】T. Matsuda et al., Electronics Letters, 29(3), 269, 1993

【非特許文献3】K. Han et al., Polym. Bull., 41, 455, 1998

【非特許文献4】J. Polym. Sci., Polym. Chem., 37, 235, 1999

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0012】

したがって、本発明の目的は、光損失および複屈折率が低く、熱安定性を有する、光導波路の製造に使用するための光硬化性樹脂組成物を提供することである。

【0013】

50

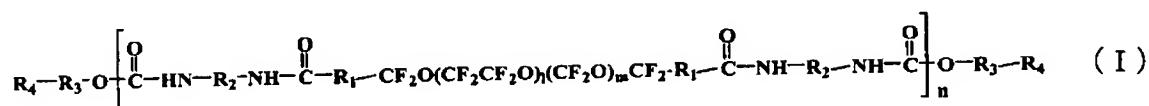
本発明の他の目的は、マイクロモールディング法を用いて前記光硬化性樹脂から製造された光導波路を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0014】

本発明の一実施態様によって、本発明では、下記式(I)のフッ素化された光硬化性ウレタンオリゴマー、反応性モノマーおよび光開始剤を含む、光導波路の製造に使用するための光硬化性樹脂組成物が提供される。

【化2】



10

【0015】

(式中、

R_1 は、 $-CH_2O$ または $-CH_2(OCH_2CH_2)_mO$ ；

R_2 は、炭素数6～100の芳香族または脂肪族炭化水素基；

R_3 は、炭素数2～10の芳香族または脂肪族炭化水素基；

R_4 は、メタ(アクリレート)基またはエポキシ基である)。

20

【発明の効果】

【0016】

本発明によれば、通常のエッチング工程なしでUV照射のみで容易に光導波路を製造できる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0017】

以下、本発明をさらに詳細に説明する。

【0018】

本発明は、下記式(I)のフッ素化された光硬化性ウレタンオリゴマー、反応性モノマーおよび光開始剤を含む、光導波路の製造に使用するための光硬化性樹脂組成物を提供する。

30

【化3】



【0019】

40

(式中、

R_1 は、 $-CH_2O$ または $-CH_2(OCH_2CH_2)_mO$ ；

R_2 は、炭素数6～100の芳香族または脂肪族炭化水素基；

R_3 は、炭素数2～10の芳香族または脂肪族炭化水素基；

R_4 は、メタ(アクリレート)基またはエポキシ基である)。

【0020】

(A) フッ素化された光硬化性ウレタンオリゴマー

本発明の組成物として用いられるフッ素化された光硬化性ウレタンオリゴマー(A)は、(a) ポリオール、(b) ジイソシアネート、(c) ヒドロキシ(メタ)アクリレートまたはヒドロキシエポキシ、(d) ウレタン反応触媒および(e) 重合開始剤を用いて製

50

造される。

【0021】

(a) ポリオール

前記フッ素化された光硬化性ウレタンオリゴマー(A)の製造に用いられるポリオールは分子量が500～10,000であり、好ましくは、フッ素化されたパーフルオロポリエーテルポリオール(perfluoropolyether polyol)またはパーフルオロポリエーテル鎖の末端に非フッ素化ポリエーテル基を有するパーフルオロポリエーテルポリオールが含まれる。前記ポリオールはオリゴマー組成物の総量を基準として20～80重量%の含量で用いられる。

【0022】

(b) ジイソシアネート

前記フッ素化された光硬化性ウレタンオリゴマー(A)の製造に用いられるジイソシアネートは、イソホロンジイソシアネート(IPDI)、1,6-ヘキサンジイソシアネート(HDI)、1,8-オクタメチレンジイソシアネート、テトラメチルキシレンジイソシアネート(TMXD1)、4,4'-ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート(HMDI)、4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート、3,3'-ジメチル-4,4'-ビフェニレンジイソシアネート、3,3'-ジメチルジフェニルメタン-4,4'-ジイソシアネート、4-ブロモ-6-メチル-1,3-フェニレンジイソシアネート、4-クロロ-6-メチル-1,3-フェニレンジイソシアネート、2,4-ジイソシアネートで末端化されたポリ(1,4-ブタンジオール)トリレン、ジイソシアネートで末端化されたポリ(1,4-ブタンジオール)イソホロン、2,4-ジイソシアネートで末端化されたポリ(エチレンアジペート)トリレン、ポリ[1,4-フェニレンジイソシアネート-コ-ポリ(1,4-ブタノール)]ジイソシアネート、ポリヘキサメチレンジイソシアネート、2,4-ジイソシアネートで末端化されたポリ(プロピレングリコール)トリレン、ポリ(テトラフルオロエチレンオキシド-コ-ジフルオロメチレンオキシド)α,ω-ジイソシアネート、2,4-トルエンジイソシアネート、2,5-トルエンジイソシアネート、2,6-トルエンジイソシアネート、1,5-ナフタレンジイソシアネートおよびこれらの混合物からなる群から選ばれることが好ましい。

10

20

30

【0023】

前記ジイソシアネートは、オリゴマー組成物の総量を基準として10～50重量%の含量で用いられる。

30

【0024】

(c) ヒドロキシ(メタ)アクリレートまたはヒドロキシエポキシ

前記フッ素化された光硬化性ウレタンオリゴマー(A)の製造に用いられるヒドロキシ(メタ)アクリレートまたはヒドロキシエポキシは、少なくとも一つの(メタ)アクリロイル基および一つのヒドロキシ基を有する化合物(c₁)、または少なくとも一つのエポキシ基および一つのヒドロキシ基を有する化合物(c₂)である。

40

【0025】

化合物(c₁)の代表的な例としては、2-ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシブチル(メタ)アクリレート、1-ヒドロキシブチル(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシ-3-フェニルオキシプロピル(メタ)アクリレート、ネオペンチルグリコールモノ(メタ)アクリレート、4-ヒドロキシシクロヘキシル(メタ)アクリレート、1,6-ヘキサンジオールモノ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールペンタ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールペンタ(メタ)アクリレート、2-メタクリロキシエチル2-ヒドロキシプロピルフタレート、グリセリンジ(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシ-3-アクリロイルオキシプロピル(メタ)アクリレート、ポリカプロラクトンポリオールモノ(メタ)アクリレートおよびこれらの混合物である。

【0026】

化合物(c₂)の代表的な例としては、グリシドールおよびエポキシ化されたテトラヒ

50

ドロベンジルアルコールがある。

【0027】

前記ヒドロキシ(メタ)アクリレートまたはヒドロキシエポキシはオリゴマー組成物の総量を基準として5～50重量%の含量で用いられる。

【0028】

(d) ウレタン反応触媒

ウレタン反応触媒は反応過程においてオリゴマー組成物の総量を基準として0.01～1重量%の含量で添加される。

【0029】

ウレタン反応触媒の代表的な例としては、ナフテン酸銅、ナフテン酸コバルト、ナフテン酸亜鉛、n-ブチルチルチラウレート、トリスチラミン、2-メチルトリエチレンジアミドおよびこれらの混合物が含まれる。
10

【0030】

(e) 重合開始剤

重合開始剤は、オリゴマー組成物の総量を基準として0.01～1重量%の含量で用いられる。

【0031】

重合開始剤の代表的な例としては、ヒドロキノン、ヒドロキノンモノメチルエーテル、パラ-ベンゾキノン、フェノチアジンおよびこれらの混合物を挙げることができる。

【0032】

前記光硬化性オリゴマー(A)は通常の方法で製造でき、具体的な製造例は次の通りである。
20

【0033】

フラスコにフッ素化されたパーフルオロポリエーテルポリオールまたはパーフルオロポリエーテル鎖の末端に非フッ素化ポリエーテル基を有するポリオールを入れ、減圧下で水分を除去する。インシアネットおよびウレタン反応触媒を反応混合物に加えながら200～300 rpmで攪拌する。反応は65～85℃の温度で-OHピークがIRスペクトル上で観察されなくなるまで約2～3時間行う。この際、反応を終結するために引き続いて触媒をさらに加えてもよい。次に、重合開始剤およびヒドロキシ(メタ)アクリレートまたはヒドロキシエポキシ化合物を反応混合物に加え、生成した混合物を70～90℃の温度で加熱し、これに適当量の触媒を加えた後、-NCOピークがIRスペクトル上で消滅するまで反応させることによって、本発明のフッ素化された光硬化性ウレタン組成物を得る。
30

【0034】

平均分子量が2,000～50,000のフッ素化された光硬化性ウレタンオリゴマー(A)は、従来のウレタンオリゴマーに比べて屈折率が低く、1.1～1.8 μmの波長領域における光透過性に優れている。

【0035】

フッ素化された光硬化性ウレタンオリゴマー(A)は、本発明の光硬化性組成物の総量を基準として20～80重量%の含量で用いられる。
40

【0036】

(B) 光反応性モノマー

本発明の組成物に用いられる光反応性モノマーは、少なくとも一つの(メタ)アクリロイル基を有する(メタ)アクリレート(B₁)または少なくとも一つのエポキシ基を有する光反応性モノマー(B₂)であってもよい。

【0037】

光反応性モノマーは(メタ)アクリロイルまたはエポキシ官能基の数によって、多官能性モノマー、2官能性モノマー、3官能性モノマーなどに区分される。

【0038】

少なくとも一つの(メタ)アクリロイル基を有する(メタ)アクリレート(B₁)はフ
50

シ素化されたか、または非フッ素化（メタ）アクリレートであってもよい。

【0039】

単官能性フッ素化された（メタ）アクリレートとしては、2-ペーフルオロオクチルエチルアクリレート、2-ペーフルオロオクチルエチルメタクリレート、2, 2, 3, 4, 4, 4-ヘキサフルオロブチルメタクリレート、2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロピルメタクリレート、トリフルオロエチルメタクリレート、2-ペーフルオロアルキルエチルアクリレートおよび2-ペーフルオロアルキルエチルメタクリレートが含まれる。

【0040】

単官能性非フッ素化（メタ）アクリレートの代表的な例としては、2-ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、2-ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、2-ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、1-ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、2-ヒドロキシ-3-フェニルオキシプロピル（メタ）アクリレート、テトラヒドロフルフリル（メタ）アクリレート、イソデシル（メタ）アクリレート、2-(2-エトキシエトキシ)エチル（メタ）アクリレート、ステアリル（メタ）アクリレート、ラウリル（メタ）アクリレート、2-フェノキシエチル（メタ）アクリレート、イソボルニル（メタ）アクリレート、トリデシル（メタ）アクリレート、ポリカプロラクトン（メタ）アクリレート、フェノキシテトラエチレングリコール（メタ）アクリレートおよびイミドアクリレートがある。

【0041】

本発明に用いられる2官能性非フッ素化（メタ）アクリレートの例としては、エトキシ化されたノニルフェノール（メタ）アクリレート、エチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ジエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、トリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、テトラエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ポリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、1, 6-ヘキサンジオールジ（メタ）アクリレート、1, 3-ブチレングリコールジ（メタ）アクリレート、トリプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、エトキシ化ビスフェノールAジ（メタ）アクリレート、シクロヘキサンジメタノールジ（メタ）アクリレートおよびトリシクロ[5. 2. 1. 0^{2.6}]デカシメタノールジアクリレートがある。

【0042】

3官能性または多官能性の非フッ素化（メタ）アクリレートの好ましい例としては、トリス[2-(アクリロイルオキシ)エチル]イソシアヌレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、エチレンオキシド付加されたトリメチロールプロパントリアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、トリス(アクリロオキシエチル)イソシアヌレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレートおよびカプロラクトン変性ジペンタエリスリトールヘキサアクリレートがある。

【0043】

少なくとも一つのエポキシ基を有する光反応性モノマー(B₂)の代表的な例としては、3, 4-エポキシシクロヘキシルメチル-3, 4-エポキシシクロヘキサンカルボキシレート、ビス-(3, 4-エポキシシクロヘキシル)アジペート、3-エチル-3-ヒドロキシメチルオキセタン、1, 2-エポキシヘキサデカン、アルキルグリシジルエーテル、2-エチルヘキシルジグリコールグリシジルエーテル、エチレングリコールジグリシジルエーテル、ジエチレングリコールジグリシジルエーテル、PEG # 200ジグリシジルエーテル、PEG # 400ジグリシジルエーテル、プロピレングリコールジグリシジルエーテル、トリプロピレングリコールジグリシジルエーテル、PPG # 400ジグリシジルエーテル、ネオペンチルグリコールジグリシジルエーテル、1, 6-ヘキサンジオールジグリシジルエーテル、水素化されたビスフェノールAジグリシジルエーテル、プロピレンオキシド変形ビスフェノールAのジグリシジルエーテル、ジブロモネオペンチルグリコールジグリシジルエーテルおよびトリメチロールプロパントリグリシジルエーテルがある。

【0044】

10

20

30

40

50

前記光反応性モノマーは本発明の光硬化性樹脂組成物の総量を基準として20～80重量%の含量で使用できる。

【0045】

(C) 光重合開始剤

本発明に使用され得る光重合開始剤は、好ましくはIrgacure #184、Irgacure #907、Irgacure #500、Irgacure #651、Darocure #1173、Darocure #116、CGI #1800、CGI #1700、UVI-6990、UVI-6974、Sarcat CD1010、Sarcat CD1011、Sarcat CD1012、Sarcat K185またはこれらの混合物であってもよい。

10

【0046】

前記光重合開始剤は、本発明の光硬化性樹脂組成物の総量を基準として1～10重量%の含量で使用できる。

【0047】

(D) 熱安定化剤

さらに、貯蔵安定性を改善する目的で、様々な酸化防止剤および熱安定化剤を使用できる。

【0048】

熱安定化剤は、本発明の光硬化性樹脂組成物の総量を基準に0.01～5重量%の含量で使用することが好ましい。

20

【0049】

(E) 酸化防止剤

本発明に使用され得る酸化防止剤の例としては、Irganox 1010、Irganox 1035、Irganox 1076(チバガイギ社製)およびこれらの混合物を挙げることができ、本発明の光硬化性樹脂組成物の総量を基準に0.01～5重量%の含量で使用されることが好ましい。

【0050】

本発明の光導波路用光硬化性樹脂組成物は通常の方法によって製造できる。好ましい製造例は次の通りである：15～50℃および60%以下の湿度条件で前記(A)～(E)成分の混合物を重合反応器に入れ、500～1000 rpmの速度で攪拌して光硬化性樹脂組成物を製造する。反応温度が15℃未満の場合はオリゴマー(A)の粘度が非常に高いため問題が発生し、50℃を超える場合は反応生成物が架橋される。

30

【0051】

光硬化性樹脂組成物の製造は組成物が1.38～1.54の範囲の屈折率および50～2000 cpsの範囲の粘度を有するように調節してもよい。さらに、本発明の樹脂組成物は貯蔵安定性に優れ、約300℃程度に高い熱分解温度および 1×10^{-4} 以下の複屈折率を有する。

40

【0052】

また、本発明のフッ素化された光硬化性樹脂組成物は光通信波長領域、すなわち、0.85μm、1.3μm、1.55μmの波長においてそれぞれ90%以上の優れた光透過度を有し、特に0.85μmの波長において0.3dB/cm程度の光損失を有する。さらに、本発明の光硬化性樹脂組成物は、従来の樹脂組成物の硬化に使用された熱硬化方式の代わりに室温におけるUV照射によって簡便に硬化させてもよい。

【0053】

また、本発明は、本発明の光硬化性樹脂組成物から光導波路を製造する方法を提供し、この方法は、本発明の光硬化性樹脂組成物を下部クラッド層としてシリコンウエハ上にコーティングした後、コーティングされた層をUV照射によって光硬化させる段階；前記光硬化性樹脂組成物をコア層としてエッチングされたコアパターンを有するシロキサンモールド上にコーティングした後、コーティングされたコア層をシリコンウエハ上にコーティングされた下部クラッド層に付着し、UV照射によってコア層を光硬化させた後、シロキ

50

サンモールドを除去する段階；および前記光硬化性樹脂組成物を上部クラッド層としてコア層上にコーティングした後、上部クラッド層をUV照射によって光硬化させる段階を含む。

【0054】

本発明に係る光導波路の製造の好ましい態様は次の通りである。

【0055】

図1において、フォトレジストによって目的とする形態のコアパターンを基板上に形成し、前記基板上にポリジメチルシロキサン層をコーティングした後、室温で放置して気泡を除去する。その後、基板上のポリジメチルシロキサンを30～100℃で2～10時間硬化させた後、基板を除去してポリジメチルシロキサンモールドを得る。得られたシロキサンモールドは本発明の光硬化性樹脂組成物でスピンドルコーティングし、この際、樹脂組成物はコアパターン部分のみを充填する。光硬化性樹脂組成物を下部クラッド層としてシリコンウエハ上にコーティングした後、コーティングされた層をUV照射によって光硬化させ、シロキサンモールド上にコーティングされたコア樹脂層の表面を下部クラッド層の物質に付着する。得られた製造物をUV照射によって光硬化させた後、シロキサンモールドを除去する。上部クラッド層物質として、本発明の光硬化性樹脂組成物をコア層にコーティングし、UV照射によって硬化させて光導波路を得る。このようなマイクロトランスマーチモールド技法を用いることによって、光導波路は従来技術に比べて短時間で簡単な工程で製造できる。さらに、本発明の方法は、フォトレジスト材料の種類によって1mm×1mmサイズの大きい光導波路、およびコアパターンに従ってシングルモードまたはマルチモード光導波路を容易に製造できる。

10

20

20

【実施例】

【0056】

以下、本発明を下記実施例によってさらに詳細に説明する。ただし、これらは本発明を例示するためのものであり、本発明の範囲を制限しない。

【0057】

オリゴマーの製造

〔製造例1〕

フッ素化されたポリエーテル(Fluorolink E10、製造元：Ausimont Co., Ltd. イタリア)375.27gおよびイソホロンジイソシアネート(IPDI)89.38gの混合物を40～60℃に加熱した後、n-ブチルチルラウレート(DBTL)0.10gを加えながら200～300rpmで攪拌した。反応を約75℃で-OHピークがIRスペクトル上で観察されなくなるまで行った。これに、ヒドロキノンモノメチルエーテル(HQ MME)0.13gおよび2-ヒドロキシエチルメタクリレート(2-HEMA)34.85gを加え、混合物を約80℃で-NCOピークがIRスペクトル上で完全に消滅するまで反応させてフッ素化された光硬化性ウレタンオリゴマーを得た。

30

【0058】

〔製造例2～13〕

下記表1に示す成分を用いて製造例1と同様な工程を繰り返して様々なフッ素化されたウレタンオリゴマーを得た。

40

【表1】

製造例	(a) ポリオール		(b) ジイソシアネート		(c) ヒドロキシ(メタ)アクリレートまたはヒドロキシエボキシ	
1	Fluorolink E10	375.27g	イソホロンジイソシアネート(IPDI)	89.38g	2-ヒドロキシエチルメタアクリレート(2-HEMA)	34.85g
2	Fluorolink E	405.53g		67.61g		26.36g
3	Fluorolink D10/H	368.23g		94.45g		36.82g
4	Fluorolink D	375.27g		89.38g		34.85g
5	Fluorolink D10	368.23g		94.45g		36.82g
6	Fluorolink E10	368.74g		96.52g		34.24g
7		391.76g		71.36g		36.38g
8		375.97g		88.62g		34.91g
9		177.94g		305.04g		16.52g
10		390.45g		72.79g		36.26g
11		375.27g	イソホロンジイソシアネート(IPDI)	89.38g	2-ヒドロキシプロピルアクリレート(2-HPA)	38.9g
12		367.39g		87.50g	4-ヒドロキシシクロヘキシルアクリレート	44.61g
13		386.68g		92.10g	グリシドール	20.72g

【0059】

光導波路用樹脂組成物の製造

[実施例1～10および比較例1]

下記表2に示す成分(A)～(D)およびZ-6030(Dow Corning Co., Ltd.)を添加剤として反応器に入れ、25℃の温度および30～60%の相対湿度下で300～1,000 rpmで攪拌して様々なフッ素化された光硬化性樹脂組成物を得た。

10

20

30

40

【表2】

		実施例										比較例1
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(A) オリゴマー	製造例1	40	40									
	製造例3			40	40							
	製造例4					40	40					
	製造例6							40	40			
	製造例11									40	40	
	UVE-150 ^{*1}											40
(B) 反応性モノマー	SR-339 ^{*2}	25	35	20	30	20	30	25	35	20	30	20
	^{*3}	25	15	20	20	20	20	25	15	20	20	10
	^{*4}			10		10				10		20
(C) 光開始剤 Darocure#1173 ^{*5}		4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
(D) 熱安定化剤 BHT ^{*6}		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Z-6030		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
合計		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

注) * 1 : Croda社製

* 2 : Sartomer社製

* 3 : 2-ペーフルオロオクチルエチルアクリレート

* 4 : 2-ヒドロキシプロピルアクリレート

* 5 : チバガイギ社製

* 6 : 2, 6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール (Aldrich社製)

10

20

30

【0060】

物性評価

前記実施例1-10および比較例1で製造された樹脂組成物の各々の物性を下記方法によつて評価し、その結果を表3に示す。

【0061】

(1) 固有粘度 (c p s) : 25°Cでブルックフィールド粘度計 (No. 41スピンドル) で測定

(2) 硬化されていない樹脂組成物の屈折率

各々の樹脂組成物の屈折率はアッベ屈折計 (Abbe's Refractometer) を用いて 23°CでナトリウムDライン (波長 589.3 μm) で測定した。

40

【0062】

(3) 屈折率 (硬化されたフィルム)

それぞれの組成物を 1500~3000 rpm の速度で 20~30 秒間シリコンウエハ上にコーティングし、コーティングされた樹脂をフュージョンランプを用いて 100 mJ/cm² の UV で光硬化させ、さらに 60~100°C で 10 分以上硬化させてシリコンウエハ上にコーティングされたフィルムを得た。厚さが 2~15 μm の硬化されたフィルムの屈折率をプリズム-カプラー (Prism-Coupler, Sairon Co. Ltd.) を用いて 850 nm の波長で測定した。電場モードにおける屈折率 (nTE) と磁場モードにおける屈折率 (nTM)

50

n_{TM} ）との差 ($\Delta (n_{TE} - n_{TM})$) をコーティングされたフィルムの複屈折率とした。

【0063】

(4) 光透過度 (%T)

各樹脂組成物を $150 \mu m$ の厚さにガラス基板上にコーティングし、その上に $100 mJ/cm^2$ のUVを照射して樹脂を硬化させた後、 $60 \sim 100^\circ C$ で 10 分以上後硬化させて硬化された樹脂フィルムを得た。その後、フィルムサンプル（サイズ： $3 cm \times 3 cm$ ）を基板から取り外し、これの光透過度を $600 \sim 1600 nm$ の波長で UV-VIS-NIRS 分光光度計（Varian社製、オーストラリア）で測定した。

【0064】

(5) 硬度 (A または D) : 光透過度測定と同じ条件で硬化させた試験片（サイズ： $5 mm \times 20 mm \times 5 mm$ ）の硬度をショア硬度計（Shore Durometer Hardness）で測定した。

10

【0065】

(6) 硬化収縮率 (%) : ASTM D-792 に従って測定した。

【0066】

(7) ガラス転移温度 (T_g) : 光透過度の測定時に用いられた試験片に対するガラス転移温度は動力学熱分析機（Dynamic Mechanical Thermal Analyzer, DMTA）を用いて $25 \sim 250^\circ C$ で $10^\circ C/min$ の昇温速度で測定した。

【0067】

(8) 热分解温度 (T_d) : 窒素雰囲気の下で熱重量測定分析器（Thermogravimetric Analyzer, TGA）を用いて $25 \sim 700^\circ C$ で $10^\circ C/min$ の昇温速度で測定した。

20

【0068】

(9) 貯蔵安定性：組成物を室温で 6 ヶ月間放置した後、外観を観察した。

【0069】

(10) 光損失 (dB/cm) : サンプル組成物の硬化されたフィルムの場合よりも低い屈折率を有する物質をシリコンウェハ上にコーティングし、その上にサンプル組成物をコーティングした後、屈折率測定で用いた試験片の製造におけると同様に硬化させた（フィルム）。得られた硬化フィルムの光損失をプリズムーカプラー（Sairon社製）で測定した。

30

【表3】

		実施例										比較例
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
液状	粘度(cPs)	250	350	150	200	250	350	350	450	250	350	300
	屈折率	1.414	1.434	1.405	1.425	1.392	1.412	1.440	1.452	1.423	1.440	1.481
硬化されたフィルム	屈折率 nTE	1.4272	1.4471	1.4182	1.4383	1.4051	1.4254	1.4532	1.4655	1.4363	1.4532	1.4941
	nTM	1.4270	1.4469	1.4178	1.4381	1.4050	1.4252	1.4527	1.4651	1.4360	1.4530	1.4933
	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
	光透過度(%)	93	92	91	90	91	90	92	91	93	92	90
	硬度	38D	65D	75D	80D	80D	85D	70D	75D	40D	70D	85D
	硬化収縮率(%)	8	7	8	8	8	7	8	8	8	7	9
	Tg(°C)	93	120	99	118	102	122	100	130	94	120	90
	Td(°C)	300	310	290	280	300	310	310	315	300	310	300
	貯蔵安定性	良好	良好	良好	良好	良好	良好	外観 変化	外観 変化	良好	良好	外観 変化
	光損失(dB/cm)	0.243	0.241	0.251	0.254	0.264	0.267	0.314	0.324	0.243	0.241	0.813

10

20

【0070】

光導波路の製造

[実施例11]

実施例1で得られたフッ素化された樹脂組成物をクラッド層としてシリコンウエハ上に3000 rpmで30秒間スピニングコーティングし、300Wの水銀ランプであるフュージョンランプを用いて100mJ/cm²のUVで光硬化させた後、次いで60～100°Cで10分以上熱硬化させた。その上にフォトレジストを用いて目的とするパターンを形成し、パターン形成された基板上にポリジメチルシロキサン層をコーティングした後、室温で放置して気泡を除去した。シロキサン樹脂を40°Cで2時間硬化させた後、基板から取り外して硬化されたシロキサン樹脂モールド(コアサイズ: 45 μm)を得た。硬化されたシロキサン樹脂モールドを実施例2で得られた光硬化性樹脂組成物でスピニングコーティングし、モールドのパターン部分を樹脂組成物で充填した。充填されたパターン部分の面がクラッド層と接触するように、コーティングされたシロキサン樹脂モールドをクラッド層がコーティングされたシリコンウエハ上に載せた。これらをフュージョンランプを用いて100mJ/cm²のUVで室温で5～15分間硬化させ、次いで60～100°Cで10分以上熱硬化させた後、シロキサン樹脂モールドを取り外した。コア層の断面に対する電子顕微鏡写真と走査電子顕微鏡写真をそれぞれ図2Aおよび図2Bに示す。上部クラッド層として、実施例1で得られた樹脂組成物をコア層の表面上に1000 rpmで20秒間スピニングコーティングした後、100mJ/cm²のUVで室温で光硬化させ、次いで60～100°Cで10分以上硬化させて光硬化性光導波路を得た。

30

40

【0071】

[実施例12]

実施例1および2の組成物の代わりに、実施例3および4で得られた樹脂組成物を用いたことを除いては、実施例11と同様な方法で光導波路を得た。

【0072】

光導波路の物性測定

実施例11および12で得られた光硬化性光導波路の物性を測定して下記表4に示し、この際、光伝播損失(propagation loss)は850nmの波長でカットーバック方法(cu

50

t-back method) で測定した。

【表 4】

	実施例 1 1	実施例 1 2
光導波路の形態	Buried type	Buried type
屈折率差 (%)	1. 39%	1. 40%
コアサイズ	45 μm × 45 μm	45 μm × 45 μm
光伝播損失 (dB/cm)	0. 245	0. 214

10

【0073】

前記結果から、本発明に従って少なくとも一つの（メタ）アクリロイル基を有するフッ素化された光硬化性ウレタンオリゴマーを含む光導波路用のフッ素化された樹脂組成物は、光透過度、熱安定性および貯蔵寿命が高いだけでなく、複屈折率が低く、本発明の樹脂組成物からマイクロモールディング技法を用いて、従来のエッチング工程なしにUV照射のみで光導波路を簡便に製造できる。

【図面の簡単な説明】

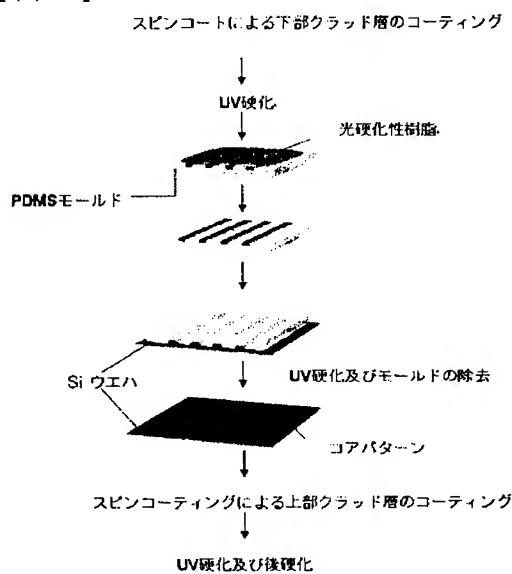
【0074】

【図1】本発明に従って、マイクロトランスファーモールド技法を用いて本発明の光硬化性物質から製造された光導波路の概略的な製造工程図である。 20

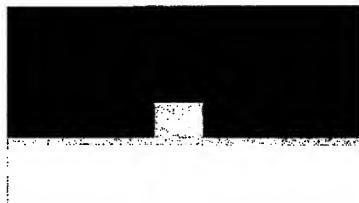
【図2A】本発明の実施例11で得られたコア層がコーティングされたウェハの断面に対する電子顕微鏡写真である。

【図2B】本発明の実施例11で得られたコア層がコーティングされたウェハの断面に対する走査電子顕微鏡写真である。

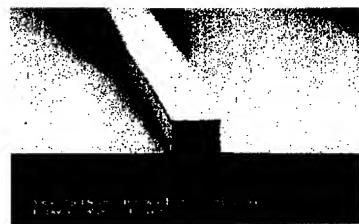
【図1】



【図2A】



【図2B】



【手続補正書】

【提出日】平成16年5月3日(2004.5.3)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

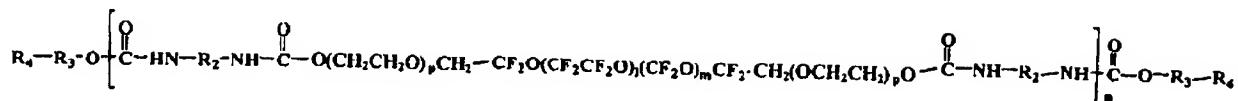
【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

下記式(I)のフッ素化された光硬化性ウレタンオリゴマー。

【化1】



(I)

(式中、

R₂は、炭素数6～100の芳香族または脂肪族炭化水素基；R₃は、炭素数2～10の芳香族または脂肪族炭化水素基；R₄は、メタ(アクリレート)基またはエポキシ基；

lおよびmは各々独立して正の整数；

pはゼロ(0)または正の整数である。)

【請求項2】

請求項1に記載の式(I)のフッ素化された光硬化性ウレタンオリゴマー、光反応性モノマーおよび光硬化性開始剤を含む、光導波路の製造に使用するための光硬化性樹脂組成物。

【請求項3】

前記フッ素化された光硬化性ウレタンオリゴマーが、ポリオールとジイソシアネートをウレタン反応触媒の存在下で反応させた後、得られた生成物と少なくとも一つの(メタ)アクリロイル基および一つのヒドロキシ基を有するヒドロキシ(メタ)アクリロイル基、または少なくとも一つのエポキシ基および一つのヒドロキシ基を有するヒドロキシエポキシをウレタン反応触媒および重合開始剤の存在下で反応させることによって製造されることを特徴とする、請求項2記載の光硬化性樹脂組成物。

【請求項4】

前記ポリオールが500～10,000の平均分子量を有し、フッ素化されたパーフルオロポリエーテルポリオールまたはパーフルオロポリエーテル鎖の末端に非フッ素化ポリエーテル基を有するパーフルオロポリエーテルポリオールであることを特徴とする、請求項3記載の光硬化性樹脂組成物。

【請求項5】

前記ジイソシアネートが、イソホロンジイソシアネート(IPDI)、1,6-ヘキサンジイソシアネート(HDI)、1,8-オクタメチレンジイソシアネート、テトラメチルキシレンジイソシアネート(TMADI)、4,4'-ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート(HMDI)、4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート、3,3'-ジメチル-4,4'-ビフェニレンジイソシアネート、3,3'-ジメチルジフェニルメタン-4,4'-ジイソシアネート、4-ブロモ-6-メチル-1,3-フェニレンジイソシアネート、4-クロロ-6-メチル-1,3-フェニレンジイソシアネート、2,4-ジイソシアネートで末端化されたポリ(1,4-ブタンジオール)トリレン、ジイソシアネートで末端化されたポリ(1,4-ブタンジオール)イソホロン、2,4-ジイソシア

ネットで末端化されたポリ(エチレンアジペート)トリレン、ポリ[1,4-フェニレンジイソシアネート-コ-ポリ(1,4-ブタノール)]ジイソシアネート、ポリヘキサメチレンジイソシアネート、2,4-ジイソシアネートで末端化されたポリ(プロピレングリコール)トリレン、ポリ(テトラフルオロエチレンオキシド-コ-ジフルオロメチレンオキシド) α , ω -ジイソシアネート、2,4-トルエンジイソシアネート、2,5-トルエンジイソシアネート、2,6-トルエンジイソシアネート、1,5-ナフタレンジイソシアネートおよびこれらの混合物からなる群から選ばれることを特徴とする、請求項3記載の光硬化性樹脂組成物。

【請求項6】

前記少なくとも一つの(メタ)アクリロイル基および一つのヒドロキシ基を有するヒドロキシ(メタ)アクリレートが、2-ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシブチル(メタ)アクリレート、1-ヒドロキシブチル(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシ-3-フェニルオキシプロピル(メタ)アクリレート、ネオペンチルグリコールモノ(メタ)アクリレート、4-ヒドロキシシクロヘキシル(メタ)アクリレート、1,6-ヘキサンジオールモノ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールペンタ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトルペンタ(メタ)アクリレート、2-メタクリロキシエチル2-ヒドロキシプロピルフタレート、グリセリンジ(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシ-3-アクリロイルオキシプロピル(メタ)アクリレート、ポリカプロラクトンポリオールモノ(メタ)アクリレートおよびこれらの混合物からなる群から選ばれることを特徴とする、請求項3記載の光硬化性樹脂組成物。

【請求項7】

前記少なくとも一つのエポキシ基と一つのヒドロキシ基を有するヒドロキシエポキシが、グリシドールまたはエポキシ化テトラヒドロベンジルアルコールであることを特徴とする請求項3記載の光硬化性樹脂組成物。

【請求項8】

前記光反応性モノマーが少なくとも一つの(メタ)アクリロイル基を有する(メタ)アクリレートまたは少なくとも一つのエポキシ基を有する光反応性モノマーであることを特徴とする請求項2記載の光硬化性樹脂組成物。

【請求項9】

前記(メタ)アクリレートが、フッ素化された(メタ)アクリレートまたは非フッ素化(メタ)アクリレートであり、前記フッ素化された(メタ)アクリレートが、2-ペーフルオロオクチルエチルアクリレート、2-ペーフルオロオクチルエチルメタクリレート、2,2,3,4,4-ヘキサフルオロブチルメタクリレート、2,2,3,3-テトラフルオロプロピルメタクリレート、トリフルオロエチルメタクリレート、2-ペーフルオロアルキルエチルアクリレートおよび2-ペーフルオロアルキルエチルメタクリレートからなる群から選ばれ；前記非フッ素化(メタ)アクリレートが、2-ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシブチル(メタ)アクリレート、1-ヒドロキシブチル(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシ-3-フェニルオキシプロピル(メタ)アクリレート、テトラヒドロフルフリル(メタ)アクリレート、イソデシル(メタ)アクリレート、2-(2-エトキシエトキシ)エチル(メタ)アクリレート、ステアリル(メタ)アクリレート、ラウリル(メタ)アクリレート、2-フェノキシエチル(メタ)アクリレート、イソボルニル(メタ)アクリレート、トリデシル(メタ)アクリレート、ポリカプロラクトン(メタ)アクリレート、フェノキシテトラエチレングリコール(メタ)アクリレート、イミドアクリレート、エトキシル化されたノニルフェノールアクリレート、エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ジエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、トリエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、テトラエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ポリエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、1,6-ヘキサンジオールジ(メタ)アクリレート、1,3-ブチレングリコールジ(メタ)アクリレート、トリプロピレングリコールジ(メタ)ア

クリレート、エトキシ化ビスフェノールAジ（メタ）アクリレート、シクロヘキサンジメタノールジ（メタ）アクリレート、トリシクロ[5.2.1.0^{2,6}]デカンジメタノールジアクリレート、トリス[2-(アクリロイルオキシ)エチル]イソシアヌレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、エチレンオキシド3モル付加されたトリメチロールプロパントリアクリレート、エチレンオキシド6モル付加されたトリメチロールプロパントリアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、トリス(アクリロオキシエチル)イソシアヌレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート、カプロラクトン変性ジペンタエリスリトールヘキサアクリレートからなる群から選ばれる請求項8記載の光硬化性樹脂組成物。

【請求項10】

前記少なくとも一つのエポキシ基を有する光反応性モノマーが、3,4-エポキシシクロヘキシルメチル-3,4-エポキシシクロヘキサンカルボキシレート、ビス-(3,4-エポキシシクロヘキシル)アジペート、3-エチル-3-ヒドロキシメチルオキセタン、1,2-エポキシヘキサデカン、アルキルグリシジルエーテル、2-エチルヘキシルジグリコールグリシジルエーテル、エチレングリコールジグリシジルエーテル、ジエチレングリコールジグリシジルエーテル、PEG #200ジグリシジルエーテル、PEG #400ジグリシジルエーテル、プロピレングリコールジグリシジルエーテル、トリプロピレングリコールジグリシジルエーテル、PPG #400ジグリシジルエーテル、ネオペンチルグリコールジグリシジルエーテル、1,6-ヘキサンジオールジグリシジルエーテル、水素化ビスフェノールAジグリシジルエーテル、プロピレンオキシド変形ビスフェノールAのジグリシジルエーテル、ジブロモネオペンチルグリコールジグリシジルエーテルおよびトリメチロールプロパントリグリシジルエーテルからなる群から選ばれることを特徴とする請求項8記載の光硬化性樹脂組成物。

【請求項11】

複屈折率が 1×10^{-4} 以下であり、熱分解温度が300°C以上であり、屈折率を1.38~1.54の範囲に調節でき、粘度を50~2000cpsの範囲に調節できることを特徴とする請求項2~10のいずれか一項に記載の光硬化性樹脂組成物。

【請求項12】

請求項2~10のいずれか一項に記載の光硬化性樹脂組成物を下部クラッド層としてシリコンウエハ上にコーティングした後、コーティングされた層をUV照射によって光硬化させる段階；前記光硬化性樹脂組成物をコア層としてエッチングされたコアパターンを有するシロキサンモールド上にコーティングした後、コーティングされたコア層をシリコンウエハ上にコーティングされた下部クラッド層に付着し、UV照射によってコア層を光硬化させた後、シロキサンモールドを除去する段階；および前記光硬化性樹脂組成物を上部クラッド層としてコア層上にコーティングした後、上部クラッド層をUV照射によって光硬化させる段階を含む、光導波路の製造方法。

【請求項13】

請求項12の方法によって製造された光導波路。

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/KR02/02381
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC7 C08G 18/42 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) C08G 18/42, C09J 4/02		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Korean Patent and applications for inventions since 1975		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CA-on CD, KIPASS, PAJ		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 6,017,603 A (NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA) Jan. 25, 2000 see the whole documents	1-13
A	JP 12-63766 A (JSR CORP, NIPPON TOKUSHU COATING KK) Feb. 29, 2000 see the whole documents	1-13
A	WO 96/23828A1(DSM N.V) Aug. 08, 1996 see the whole documents	1-10
A	JP 10-237392 A (SHOWA DENKO KK) Sep. 08, 1998 see the whole documents	1-10
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C.		<input checked="" type="checkbox"/> See patent family annex.
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		
Date of the actual completion of the international search 07 APRIL 2003 (07.04.2003)		Date of mailing of the international search report 07 APRIL 2003 (07.04.2003)
Name and mailing address of the ISA/KR  Korean Intellectual Property Office 920 Dunsan-dong, Seo-gu, Daejeon 302-701, Republic of Korea Facsimile No. 82-42-472-7140		Authorized officer LEE, Suk Ju  Telephone No. 82-42-481-8149

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No.
PCT/KR02/02381

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 6,017,603 A	Jan. 25, 2000	EP 0768353 A4 US 6,284,185 B1 WO 09740115 A1	Oct. 14, 1998 Sep. 04, 2001 Oct. 30, 1997
JP 12-63766 A	Feb. 29, 2000	WO 0011097 A1 US 6,440,519 B1 EP 1112330 A1	Mar. 02, 2000 Aug. 27, 2002 Jul. 04, 2001
WO 96/23828 A1	Aug. 08, 1996	JP 11-503768T2 EP 0807136A1	Mar. 30, 1999 Nov. 19, 1997
JP 10-237392 A	Sep. 08, 1998	None	

フロントページの続き

(51) Int. Cl.⁷ F I テーマコード (参考)
 G 0 2 B 6/12 G 0 2 B 6/12 N

(81) 指定国 AP (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR), OA (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, N, O, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

(74) 代理人 100075672
 弁理士 峰 隆司
 (74) 代理人 100109830
 弁理士 福原 淑弘
 (74) 代理人 100084618
 弁理士 村松 貞男
 (74) 代理人 100092196
 弁理士 橋本 良郎
 (72) 発明者 キム、マル・ソン
 大韓民国、キュンキード 425-857、アンサンーシ、イードン、ナンバー 540-5 20
 1
 (72) 発明者 オー、ウォ・ジョン
 大韓民国、キュンキード 425-160、アンサンーシ、イードン、ナンバー 549-2 20
 3
 (72) 発明者 ビュン、ヒュン・ホ
 大韓民国、キュンキード 421-190、ブチョンーシ、オジョンシ、コガンボンードン、ナンバー 252-1
 (72) 発明者 キム、ジュン・ウク
 大韓民国、キュンキード 449-761、ヨンギンーシ、スジ・ユプ、ボウォン・アパートメント 101-1005
 (72) 発明者 ハン、クワン・ソ
 大韓民国、ソウル 135-270、カンナムー、ドゴクードン、ヨクサム・ラッキー・アパートメント 103-1307
 (72) 発明者 オー、ジュン・ヒュン
 大韓民国、キュンキード 431-060、アンヤンーシ、ドンガシ、クワンヤンードン、ヒュンダイマンション 6-104

F ターム(参考) 2H047 QA05

2H050 AB42Z
 4J034 CA02 CB01 CC26 CC38 CC45 CC52 CC62 FA02 FB01 FC01
 FD01 FE08 HA01 HA02 HA07 HB17 HC03 HC12 HC13 HC17
 HC22 HC46 HC52 HC61 HC64 HC67 HC71 HC73 JA42 RA13
 RA14
 4J036 AB01 AB09 AB10 AJ01 AJ09 AJ10 AJ17 AK19 JA15
 4J127 AA01 AA03 BB031 BB111 BB221 BC021 BC151 BD441 BD471 BE21Y
 BE211 BE24Y BE241 BF17X BF171 BF62X BF621 BF63X BF631 BG04X
 BG04Y BG041 BG05X BG051 BG08X BG081 BG14X BG141 BG17Y BG171
 BG27Y BG271 BG28X BG281 CB151 CB152 CC061 CC092 FA22

る)。

(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(19) World Intellectual Property Organization
International Bureau(43) International Publication Date
4 September 2003 (04.09.2003)

PCT

(10) International Publication Number
WO 03/072625 A1(51) International Patent Classification⁷: C08G 18/42

(21) International Application Number: PCT/KR02/02381

(22) International Filing Date:
18 December 2002 (18.12.2002)

(25) Filing Language: English

(26) Publication Language: English

(30) Priority Data:
2002-11002 28 February 2002 (28.02.2002) KR

(71) Applicant (for all designated States except US): LUVANTIX CO., LTD. [KR/KR]; #403-2, Moknae-dong, Kyungki-do, Ansan-si 425-110 (KR).

(72) Inventors; and

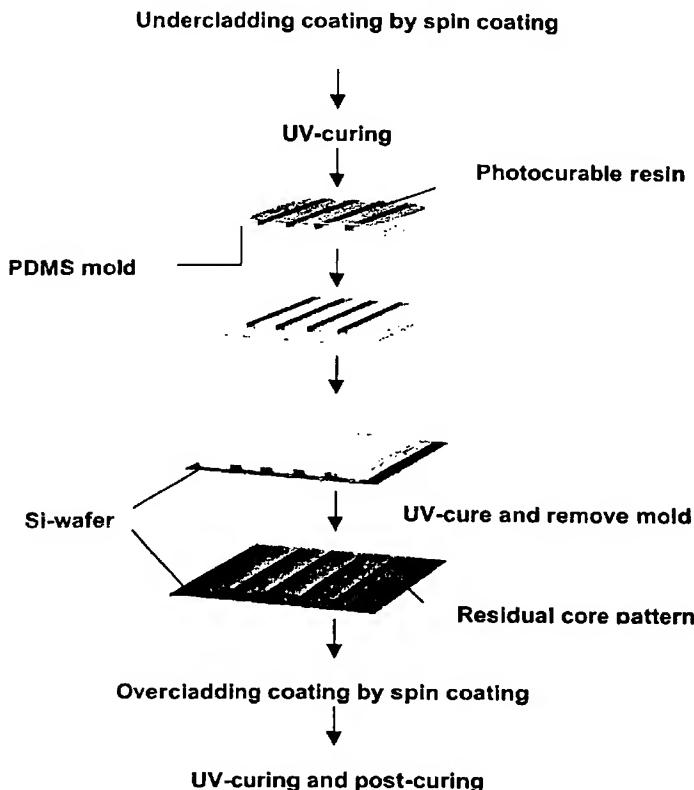
(75) Inventors/Applicants (for US only): KIM, Mal, Soon [KR/KR]; 201, #540-5, I-dong, Kyungki-do, Ansan-si 425-857 (KR). OH, Woo, Jeong [KR/KR]; 203, #549-2, I-dong, Kyungki-do, Ansan-si 425-160 (KR). BYUN, Hyun, Ho [KR/KR]; #252-1, Kogangbon-dong, Ojeong-gu, Kyungki-do, Bucheon-si 421-190 (KR). KIM, Jung, Wook [KR/KR]; Bowon Apt. 101-1005, Suji-eup, Kyungki-do, Yongin-si 449-761 (KR). HAN, Kwan, Soo [KR/KR]; Yeoksam Lucky Apt. 103-1307, Dogok-dong, Kangnam-gu, Seoul 135-270 (KR). OH, Jung, Hyun [KR/KR]; Hyundaimansion 6-104, Kwanyang-dong, Dongan-gu, Kyungki-do, Anyang-si 431-060 (KR).

(74) Agents: JANG, Seong, Ku et al.; 17th Fl., KEC Building, #275-7, Yangjae-dong, Seocho-ku, Seoul 137-130 (KR).

(81) Designated States (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU,

[Continued on next page]

(54) Title: PHOTOCURABLE RESIN COMPOSITION FOR OPTICAL WAVEGUIDE AND OPTICAL WAVEGUIDE MADE OF THE SAME



(57) Abstract: A photocurable resin composition useful for preparing an optical waveguide comprises a fluorinated photocurable urethane oligomer of formula (I), a reactive monomer and a photocurable initiator: wherein: R₁ is -CH₂O- or -CH₂(OCH₂CH₂)_mO-; R₂ is an aromatic or aliphatic hydrocarbon group containing from 6 to 100 carbon atoms; R₃ is an aromatic or aliphatic hydrocarbon group containing from 2 to 10 carbon atoms; and R₄ is a (meth)acrylate or epoxy group.



CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR, OAPI patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Published:

— with international search report

(84) **Designated States (regional):** ARIPO patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), Eurasian patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), European patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE,

For two-letter codes and other abbreviations, refer to the "Guidance Notes on Codes and Abbreviations" appearing at the beginning of each regular issue of the PCT Gazette.

PHOTOCURABLE RESIN COMPOSITON FOR OPTICAL WAVEGUIDE AND OPTICAL WAVEGUIDE MADE OF THE SAME

FIELD OF THE INVENTION

5 The present invention relates to a photocurable resin composition having improved thermal stability and optical transmittance, and optical waveguides made of the same via micro-molding technique.

BACKGROUND OF THE INVENTION

10 In the field of telecommunications, development of optical waveguide has been recognized as a critical issue enabling large capacity communications. Glass or other inorganic crystalline materials have conventionally been used as materials for producing optical communication parts such as an optical waveguide. These materials, however, have the 15 disadvantages of high cost and difficulty in processing.

In recent years, polymer materials, such as PMMA (polymethyl methacrylate) and PS (polystyrene), have become more popular thanks to their lower cost and easier processing ability than glass or other inorganic crystalline materials. Use of such material can provide a film-type optical 20 waveguide with wider area and higher flexibility than the conventional ones. Such use also makes it possible to obtain a functional optical waveguide by incorporating functional compounds or functional groups into such polymer materials.

However, PMMA and PS show absorption ascribable to C-H bonds in 25 their molecules in the near-infrared region, i.e., 1.0~1.8μm; and thus deuterated or fluorinated PMMA (that is, PMMA whose hydrogen atoms are substituted with deuterium or fluorine atoms) has been developed. Such deuterated or fluorinated PMMA shows absorption in the far-infrared region as shifted from the near-infrared region.

30 The above-described PMMA, PS and deuterated or fluorinated PMMA constituting a core of the optical waveguide, however, have low glass transition temperatures. For instance, both PMMA and deuterated PMMA have a glass transition temperature of about 100°C, so that these materials may easily be softened due to heat treatment, thereby having a low 35 thermal stability (see S. Imamura et al. Electronics Letters, 27, 1342, 1991).

To solve the problem of low thermal stability, NTT Co., Ltd.